

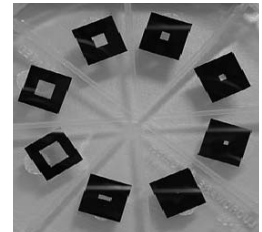
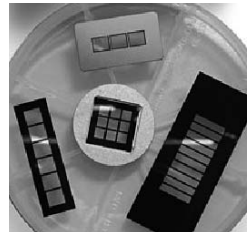
Silson

英国Silson社は、X線フィルター、またはTEM(透過型電子顕微鏡)用途に最適な窒化シリコン薄膜の製造・供給を行っております。短納期、低価格でのご提供が可能で、金属蒸着を施した薄膜等各種カスタム仕様にも柔軟に対応いたします。また、リソグラフィ技術を用いたフレネルゾーンプレート、解像度測定用テストパターン等の供給もいたします。

窒化シリコン薄膜

- ・各種コーティング(金属:Al,Au,Ti,Cr,Ni,Zr,ポリマー:Novolac,Parylene,SU-8)可能
- ・表以外の仕様にも柔軟に対応
- ・軟X線、硬X線(要金属コーティング)用フィルターに最適
- ・金グリッド、アルミニウムサポートリング、スペーサ等のオプションにも対応可能

1. 薄膜サイズ	0.25mm, 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm角
2. 薄膜厚さ	20nm, 30nm, 50nm, 75nm, 100nm, 150nm, 200nm 500nm, 1000nm
3. 基盤サイズ	5.0mm, 7.5mm, 10.0mm角
4. 基盤厚さ	100 μ m, 200 μ m, 381 μ m, 525 μ m

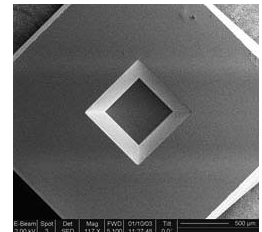
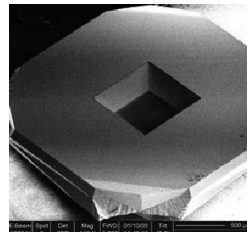


TEM*用窒化シリコン薄膜

*TEM(透過型電子顕微鏡)

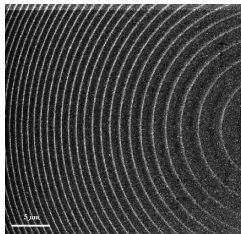
- ・薄膜表面精度が高く、化学的に無害で、生体サンプルホルダに最適
- ・電子ビーム、軟X線に対し、優れた透過効率を提供

1. 薄膜サイズ	0.25mm, 0.5mm角
2. 薄膜厚さ	20nm, 30nm, 50nm, 75nm, 100nm, 150nm, 200nm
3. 基盤サイズ	2.65mm角
4. 基盤厚さ	100 μ m, 200 μ m

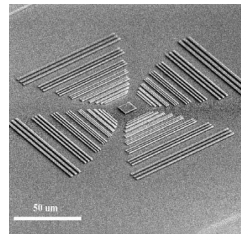


各種リソグラフィ製品

- ・フレネルゾーンプレート、リニアゾーンプレート、テストパターン、テストチャートの供給が可能



- ・X線集光ゾーンプレート
- ・最外郭幅: 50nm min
- ・基盤材料: SiN
- ・ゾーン材質: PMMA、タングステン、金、その他



- ・X線解像度測定用テストパターン
- ・最小パターン幅: 50nm min
- ・パターン厚み: 1 μ m max
- ・ゾーン材質: PMMA、タングステン、金、その他

※カスタム仕様にも柔軟にご対応致します。

CORNES DODWELL

コーンズ ドッドウェル株式会社

東京: 〒150-8451 東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル
大阪: 〒550-0005 大阪市西区西本町1-13-40 コーンズハウス

TEL (03)5774-9978 (直通)
TEL (06)6532-1012 (直通)

URL <http://www.cornes-dodwell.co.jp>